

高分子反応の新展開

—溶液・バルク系から表面・界面での反応まで—

日時：2013年2月8日（金）10:20～17:30

会場：東工大蔵前会館ロイヤルブルーホール

1. 分解性を有する架橋・硬化ポリマーの
合成と応用

(大阪府大) 白井正充

2. 有機金属化学に基づく反応性高分子の
設計と元素ブロックπ共役高分子への展開

(東工大) 富田育義

3. 高分子反応を利用したエンブラへの
感光性付与：反応現像画像形成法

(横浜国立大) 大山俊幸

4. 環状・多環状テレケリクスのクリック・
クリップ反応による高分子トポロジー設計

(東工大) 手塚育志

5. クリック反応を利用した芳香族系高分子の
合成と機能

(東工大) 道信剛志

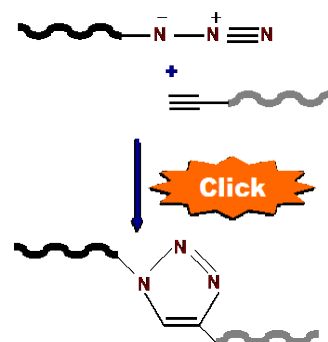
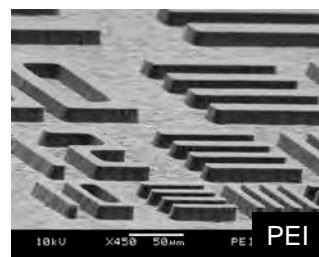
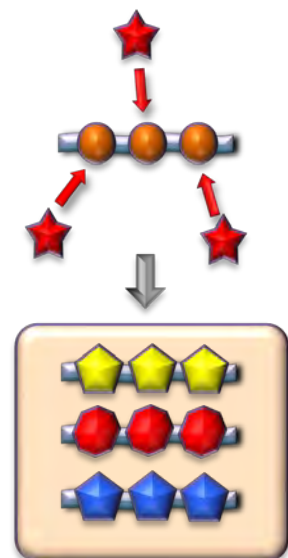
6. ATRPを利用したテレケリックポリ
アクリレートの工業化とその反応

(新化学技術推進協会 [JACI]、カネカ) 中川佳樹

7. 低分子オリゴマーの界面への偏析を利用
した接着力向上

(東亜合成) 佐々木裕

[敬称略]



会誌「高分子」2012年11月号とのコラボレーション企画です。新しいコンセプトや材料開発を指向した高分子反応の新展開をご紹介します。

定員 100名

参加費 ①企業 10,500円 ②大学・官公庁 5,250円 ③学生 1,050円

④名誉・終身・FII-・J-「ト」会員・シヤ会員 2,100円

※当日に会場でのご参加も可（定員になり次第締め切らせていただきます）

詳細・お申込み：<http://www.spsj.or.jp/entry/annaidetail.asp?kaisaino=821>



12-2 高分子学会講演会

高分子反応の新展開-溶液・バルク系から表面・界面での反応まで-

＜趣旨＞ 高分子反応は、ポリマーを出発原料とした様々な反応であり、リビングラジカル重合やクリックケミストリーなどの精密高分子合成の発展に伴って、近年、大きな進化を遂げている。新しいコンセプトや材料開発を指向した高分子反応の基本原則に関して、溶液・バルク系から表面・界面での反応まで、本分野を先導するフロントランナーの講師陣に最新動向を紹介して頂く。

主催 高分子学会 行事委員会
協賛 (予定)日本化学会、応用物理学会、日本材料学会
会期 2013年2月8日(金) 10:20~17:30
会場 東工大蔵前会館 ロイヤルブルーホール (東京都目黒区大岡山 2-12-1)
交通 東急目黒線・東急大井町線 大岡山駅下車徒歩約1分
<http://www.somuka.titech.ac.jp/ttf/index.html>

プログラム

＜10:20-11:10＞

1. 分解性を有する架橋・硬化ポリマーの合成と応用 (大阪府大) 白井正充
架橋・硬化ポリマーは、優れた機械的強度や高耐熱性を有する材料であり、従来から広く使われている。このような材料に分解性を付与すると、これまでとは違った新しい材料設計が可能になる。ここでは、分解性を有する架橋・硬化ポリマーの設計・合成と材料としての応用について、最近の研究を紹介する。

＜11:10-12:00＞

2. 有機金属化学に基づく反応性高分子の設計と元素ブロック π 共役高分子への展開 (東工大) 富田育義

主鎖に多彩な反応性を示すメタラサイクル部位をもつ有機金属高分子を中間体として用いる、様々な元素および元素ブロックを付与した π 共役高分子の合成に関する研究内容を概説する。

＜13:00-13:50＞

3. 高分子反応を利用したエンブラへの感光性付与：反応現像画像形成法 (横浜国立大) 大山俊幸
本講演では、エンブラ中に存在するカルボン酸類縁基(イミド基、エステル基、カーボネート基など)と現像液中の求核剤との高分子反応を利用し、市販エンブラなどに簡便に感光性を付与し微細パターン形成を可能にする「反応現像画像形成法」について述べる。

＜13:50-14:40＞

4. 環状・多環状テレケリクスのクリック・クリップ反応による高分子トポロジー設計 (東工大) 手塚育志
高分子トポロジー化学の最近の成果である、ESA-CF法と高分子間クリック反応および高分子内クリップ(オレフィンメタセシス)反応を組み合わせた、多環状高分子の効率的合成手法を紹介する。

＜15:00-15:50＞

5. クリック反応を利用した芳香族系高分子の合成と機能 (東工大) 道信剛志
クリック反応は機能性高分子の効率的合成に用いられている。本講演では、電子豊富アルキンとアクセプター分子の付加反応を新しいクリック反応と捉え、芳香族系高分子の機能開拓に用いた例を紹介する。

＜15:50-16:40＞

6. ATRPを利用したテレケリックポリアクリレートの工業化とその反応 (新化学技術推進協会(JACI)、カネカ) 中川佳樹
原子移動ラジカル重合(ATRP)を利用して、両末端に架橋性官能基を有するテレケリックポリアクリレートを開発し、世界初の工業化に成功した。このポリマーの開発と共に、末端官能基の反応についても説明する。

＜16:40-17:30＞

7. 低分子オリゴマーの界面への偏析を利用した接着力向上 (東亜合成) 佐々木裕
高分子材料を接着に应用する場合、基材界面での振る舞いが重要な役割を果たす場合が多い。この講演では、界面への低分子オリゴマーの偏析を積極的に利用することにより、接着力を大幅に向上させた例について紹介させていただく。

参加要領

- 1) 定員 100 名
- 2) 参加費 ①企業 10,500 円②大学・官公庁 5,250 円 ③学生 1,050 円
④名誉・終身・フェロー・ゴールド会員・シニア会員 2,100 円
年会費制会員^{※1)} の団体からのご参加は、何名様でも割引料金となります。
a) 会社 8,400 円 b) 大学・官公庁 4,200 円
^{※1)} 詳細は <http://www.spsj.or.jp/c18/nenkaihisei.html> をご覧ください。
- 3) 申込方法 学会ホームページ <http://www.spsj.or.jp/entry/> または下記申込書にご記入の上、
FAX または郵送にてお申込み下さい。随時、参加証と請求書を送付いたします。
- 4) 参加費の支払い 請求書到着後 2 月末日までにお願いします。
銀行・郵便振替の領収をもちまして本会からの領収書とさせていただきます。
振込先銀行：三菱東京 UFJ 銀行 銀座支店 (普通) 1126232 (社)高分子学会
郵便振替：00110-6-111688 (社)高分子学会
- 5) その他 演題・講演者は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。

申 込 先 公益社団法人高分子学会 12-2 高分子学会講演会係
〒104-0042 東京都中央区入船 3-10-9 新富町ビル 6F
TEL 03-5540-3770 FAX 03-5540-3737

行事参加申込 QR コード
<http://www.spsj.or.jp/entry/>



公益社団法人高分子学会 12-2 高分子学会講演会 行

FAX 03-5540-3737

12-2 高分子学会講演会 参加申込書

参加者名	
勤務先・部署	
電話	FAX
E-mail	
今後、高分子学会主催行事案内の E-mail 送付 <input type="checkbox"/> 希望する <input type="checkbox"/> 希望しない	
勤務先住所	〒
送金方法 (送金額を記入し、該当するもの (□) にチェックしてください。)	
送金額 ¥ _____	
(所属: <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> 大学/官公庁 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 名誉 <input type="checkbox"/> 終身 <input type="checkbox"/> フェロー <input type="checkbox"/> ゴールド会員 <input type="checkbox"/> シルバ会員 <input type="checkbox"/> 年割)	

【個人情報について】
こちらに明記いただいた情報は、本行事の運営以外の目的で利用しません。